



2025年12月25日

各 位

会 社 名 株式会社 QD レーザ
代表者名 代表取締役社長 大久保 潔
(コード番号：6613 東証グロース)
問合せ先 常務執行役員経営企画室長 武政 敬三
(TEL. 044-333-3338)

固定資産の取得に関するお知らせ

当社は、2025年12月25日開催の取締役会において、下記のとおり、固定資産の取得に向けた発注を行うことについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取得の理由

当社のレーザデバイス事業は、顧客基盤の拡大と用途領域の広がりを背景に、継続的な成長を遂げており、今後の更なる事業拡大に向けて製造体制の強化が重要な経営課題となっております。当社はセミファブレス体制を採用する一方、独自製品の競争力の源泉であるエピタキシャル成長工程については自社でMBE装置（分子線エピタキシー装置）（注）と呼ばれる製造設備を保有・運用しており、同工程は製品性能および供給能力の両面で事業成長を支える中核プロセスです。

近年の需要拡大に伴い、既存MBE装置の稼働率は高水準で推移しており、将来の受注拡大に対応するための生産余力の確保や、製造工程の安定性向上が必要な状況となっております。また、新製品・新用途向けの開発案件も増加しており、開発と量産を両立できる製造基盤の整備が求められています。こうした状況を踏まえ、当社は既存MBE装置よりも大型で高い生産能力を有するMBE装置（設置用クリーンルームおよび装置冷却用配管を含む）を新たに導入することいたしました。

本固定資産の取得により、生産能力を現在の約4倍規模に拡大できる見込みであり、生産能力の拡大と製造体制の冗長化を同時に実現することで、安定供給体制を強化するとともに、成長分野における受注機会の獲得および新製品開発の加速を図ります。これにより、当社レーザデバイス事業の競争力を高め、中長期的な企業価値の向上につなげてまいります。

なお、2025年12月19日公表「中小企業成長加速化補助金」交付決定に関するお知らせ」記載の5億円の補助金を本固定資産の取得に充当いたします。

2. 取得資産の内容

- (1) 資産の名称 MBE装置、設置用クリーンルームおよび装置冷却用配管
- (2) 設置場所 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町206-1
- (3) 取得資金 中小企業成長加速化補助金および銀行借入（予定）
- (4) 検収予定 2027年4月頃

3. 取得価額

取得価額は約11億円であり、適時開示制度における軽微基準に該当する当社直前会計年度の純資産額（5,219,265千円）の30%未満となります。

4. 今後の見通し

本固定資産の取得が当期（2026年3月期）の業績に与える影響は軽微ですが、今後開示が必要な情報が発生した場合は速やかに開示いたします。

(注) MBE装置・・・分子線エピタキシー (Molecular Beam Epitaxy) 装置のこと、超高真空環境下で、原料を加熱して発生させた原子や分子のビーム（分子線）を基板に当てて、原子層レベルで精密な結晶構造の薄膜（エピタキシャル層）を成長させるための装置。

以上